## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-043213

(43) Date of publication of application: 13.02.1990

(51)Int.Cl.

C08G 18/83 B29C 61/06 C08J 5/00 // B29K 75:00

(21)Application number : 63-098781

(71)Applicant: NAKAMURA HOSHITERU

(22)Date of filing:

20.04.1988

(72)Inventor: NAKAMURA HOSHITERU

## (54) SHAPE-MEMORY MOLDED ARTICLE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a molded article having shape memory characteristics by using a polyurethane resin having a Tg in a specified range, a hardness (Shore D) above a specified value below the Tg and another hardness below a lower specified value at the Tg or higher. CONSTITUTION: A molded article having a shape memory characteristics is obtd. by using a polyurethane resin having a glass transition temp. (hereinbelow described as Tg) in the range of 0-100° C and a hardness (Share D) of 65 or larger below the Tg and a Shore D hardness of smaller than 55 at the Tg or higher. A deformation is given to a molded item constituted of this polyurethane resin at the Tg or higher an this deformation is fixed by cooling it below the Tg of this resin. In using the molded item it is heated at the Tg or higher to reconvert it to its original shape.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## 19日本国特許庁(JP)

11 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平

平2-43213

(5) Int. Cl. 5 C 08 G 18/8 識別記号 NCV 庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)2月13日

C 08 G 18/83 B 29 C 61/06 C 08 J 5/00 B 29 K 75:00 NGV CFF

7602-4 J 7446-4 F 8720-4 F 4 F

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

❷発明の名称

形状記憶性成形体

②特 顧 昭63-98781

②出 顧 昭63(1988) 4月20日

⑦発明者 中村

星 輝 静岡県

静岡県引佐郡細江町中川888-299番地

⑪出 願 人 中 村 星 輝 静岡県浜松市三幸町480-5番地 浜松プラテツク内

明 細 書

#### 1. 発明の名称

形状記憶性成形体

#### 2. 特許請求の範囲

(1) ガラス転移温度(Tg)が0~100℃の範囲であるポリウレタン出脂から構成された形状記憶性を有する成形体。

(2) 特許請求の報酬第1項記載のポリウレタン出 脂がガラス転移温度(Tg)未満で硬さ(ショア ーD) 6 5 以上、ガラス転移温度以上で硬さ(ショアーD) 5 5 未満であることを特徴とする形状 記憶性を有する成形体。

(3) 特許請求の範囲第1項および第2項記載のポリウレタン問胎から構成された成形体にガラス転移温度(Tg)以上の温度で変形を与え、ついで当該制船のガラス転移温度(Tg)未満に冷却して変形を固定し、使用に際し当該制船のガラス転移温度(Tg)以上に加熱して再び元の形状に回復させることを特徴とする形状記憶性を有する成形体。

## 3. 発明の詳細な説明

本発明はポリウレタン側別から構成された形状記憶性を有する成形体に関するものでありたのでありたはポリウレタン側別から構成されり、成形はしくはポリウレタン側間から構成された形理度(以下Tgという)と表し、の大きな形を与え、で当該側脂の下の大きな形を固定というというというである。というというというというには、である。

ゴム、ブラスチックなどの樹脂は常温で外力を加えると変形し、外力を取り去ると元に戻るという性質を有する。従来のポリウレタン樹脂においては外力を加えることにより変形し、外力を収り去った後も変形した形状を維持し、温度が上昇したときに元の形状に戻るという形状記憶性を有するものはなかった。

形状記憶性を育する素材としては、ある種の金属、形状記憶合金がよく知られており、形状記憶

## **狩開平2-43213 (2)**

性を育する出胞材料としては、ノルボルネン系例 船(特開昭 5 9 — 5 3 5 2 8)(特開昭 6 1 — 9 1 2 4 4)、トランスインプレン系 樹脂(特開昭 5 5 — 9 3 8 0 6)(特願昭 6 1 — 0 3 4 1 5 0 )、ビニル系誘導体とアクリル酸誘導体または合成ゴムとの混合物(特開昭 6 3 — 1 7 9 5 2) が挙げられるにすぎない。

本発明者はポリウレタン樹脂の用途を開発すべく努力を重ねた結果本発明に達したものである。

本発明は形状紀億性を有するポリウレタン樹脂から構成された成形体を提供するものである。

本発明の形状記憶性を有する成形体は下gが 0 ~1 0 0 での範囲であり、 下g未満で硬さ(ショナー D) 6 5 以上、 Tg以上で硬さ(ショナー D) 5 5 未満の特徴を有するポリウレタン樹脂から 構成された成形体であり、 当該成形体にTg以上で変形を与え、ついでTg未満に冷却して変形を固定し、使用に際し当該成形体のTg以上に加熱する方法を用いることによって与えた変形を除去し、形状を回復させるものである。 本発明で使用されるポリウレタン出版はTgが 0~100で、好ましくは20~80での範囲で あるものが用いられる。Tgが0で未満では形状 記憶性を育する成形体を冷却し変形を固定しても 、常温で変形が回復するので実用に適さない。T gが100で以上では当該成形体を構成するポリ ウレタン組脂の長期使用可能温度を超えるので好 ましくない。

以下、本発明に適するポリカレタン樹脂の構成

について詳述する。

本発明で用いられるポリウレタン樹脂は(A)平均官能基数 2.0~6.0 且つ数平均分子量 250~1.000のポリヒドロキシル化合物と(B) 自機ポリイソシアネートを公知の方法で反応させて成る組成物から形成される。

ボリヒドロキシル化合物の平均官能基数が2.0未満ではポリウレタン出脂の充分な健康を得にくく実用に供し難い。平均官能基数が6.0以上ではポリウレタン出脂のTgが100でを超えるため好ましくない。好通な官能基数は2.0~6.0、より好ましくは2.0~4.0の範囲である。

ポリヒドロキシル化合物の数平均分子型は1.000以上ではポリウレタン出脂のTgが0 で未満、あるいはTg未満の硬さ(ショアーD)が65未満となるため好ましくない。数平均分子量が250未満ではポリウレタン出脂のTgが100でを超える、あるいはTg以上の硬さ(ショアーD)が55以上となるため好ましくない。好過な

数平均分子貸は250~1,000、より好ましくは300~700の範囲である。

本発明に用いるポリとしてかい化合物は通常 ウレタン樹脂に用いるものが使用できる。例えば 、多価アルコールにエチレンオキサイド及オキレンオキサイド等のアルキレンオキサイド ではプロピレンオキサイド等のアルキレンオキサイ によりなポリアルテルポンをしたポリエステルポリオアル を応により生成液状ポリブタジェン・ルル によりなポリブタジェステルポリアル をによりなポリブタジェステルポリアル が、これらの二種以上の混合物を使用することもできる。

本発明に用いる有機ポリイソシアネートとしては未満基として少なくとも2個のイソシアネート 括を有する脂肪族あるいは芳苓族有機化合物であ り、ポリウレタン樹脂工業において公知なポリイ ソシアネートがいずれも使用できる。例えば、4 ・ 4 — ジフェニルメタンジィソシアネート、トリ レンジイソシアネート、ポリアルキレンポリフェニルイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、およっト、およっト、カフチレンジイソシアネート、およっトの誘導体等を挙げることができ、またこれらの二種以上の混合物を使用することもできる。また、前記有機ポリイソシアネートを含物を付加した未満基としてイソシアネート基を含有するプレポリマーも使用できる。

本発明に用いるボリウレタン樹脂は前記ボリヒドロキシル化合物と有機ポリイソシアネートとの反応により得られるが、他に必要に応じて本発明の目的を損なわない範囲で副原料を併用してもよい。 測原料としては、例えば触媒、 充漿剤、 発化剤、 安定剤、 着色剤、 難燃剤、 発泡抑制剤、 界面活性剤などがある。

前記版料を使用してワンショット法、プレポリマー法、ペプレポリマー法などのポリウレタン工業において公知の方法によってポリウレタン樹脂から構成された成形体が製造される。当該成形体

の製造はキャスト等により直接シート、フィルム あるいは所定の形状の成形体とする。 成形条件は 常温成形、加热収形ともに利用でき、本発明の目 的とする効果を顕著しない限り特に制限はない。

本発明の成形体に実際の使用に当たって変形を与える温度は成形体を構成するポリウレタン樹脂のTg以上であれば良く、好ましくはTg~Tg+30℃の範囲である。変形の与え方も特に制限はない。成形体の形状や肉厚等に応じて成形体を変形させ易い温度雰囲気(例えば加熱空気中、加熱液体中、水蒸気中等)下に置き、君手あるいは適当な道具で変形を与えることができる。

変形を固定するには、Tg以上で変形を与えられた当該成形体を変形を保持したままTg未満に 冷却、好ましくは無冷しなければならない。

成形体から変形を取り除き、所定の形状の成形体に戻すには、Tg温度以上、好ましくはTg~Tg+30でに加熱すれば良く、変形は自動的に 録去され形状は回復する。温度を高くする程成形体が所定の形状に画復する時間は短くなる。加熱

の手段も変形付与時と同様に制限はなく、加熱空 気、水蒸気等を用いて成形体を加熱すれば良い。

本発明を実施すれば一旦変形させた胶形体を所 定の形状まで回復しうるので、成形体の使用に際 して、その形状のままでは装着や組み立て、輸送 等が困損な場合に変形を与えて取扱いが容易とな 、る様に形状を変え、装着や組み立て等が終了した 後で加熱により所定の形状にまで回復させること かできるから、本発明の形状紀像性を存する成形 体をパイプや電線等の接合材やシール材、パイプ や棒状物体の内、外部ラミネート材、物体の被覆 材、締め付けピンやクランプなどの工作、建築用 固定材、ギブスなどの医療機器材料、未使用時に は折り畳んでおき使用時に形状を回復させて使用 する抵帯用容器や食器類、自動車パンパーなどの 衝型吸収後の変形同復を必要とする部材、住宅の 間仕切りの間隙防止材、玩具用部材、文具材や教 材、造花やブローチなどの装飾品材、熱感応のス イッチなどの電気部品材、パッキンやOリング、 型取り材、仮面やかつら下地材などとして使用す

ることができる。但し、用途はこれらに限定されるものではない。

以下実施例により本発明を具体的に説明する。

実施例1~14及び比較例1~4

当該成形体を丁g+20℃の熱限乾燥機に入れ 10分間放製した後、室温雰囲気下に取り出した 直後に円柱状に変形を与えたまま水中にいれ急冷 し変形を固定させた。再び室温下にもどした当該 成形体の固定された変形が長く維持され変化が無いことを評価した。

更にこのものを、再度下g+20℃の熱風乾燥 機にいれ、完全に元の形状に回復することを評価 した。

性能は下記の方法で評価した。その結果を、実施例1~6及び比較例1については表1に、実施例7~9及び比較例2については表2に、実施例10~14及び比較例3~4については表3に、それぞれ示す。

性能評価方法は次のとうりである。

#### 〇硬さ試験

ショアー硬さ試験方法、 D 型試験機 (J 1 S - Z - 2 2 4 6) にて測定した。

○ガラス転移温度(Tg)

硬さが温度の上昇によって急激に低下する温度 で評価した。

〇形状紀修性の有無判定

有り:形状紀億性があり、Tg未満で変形の固 定とTg以上で完全な形状の回復をとも に有する。

なし: Tg未満もしくは常温での変形の固定が 不可もしくは不完全な場合、あるいはT g以上での間定された変形の固復が不可 安 :

	No.			実施 例1	実施 例 2	実施 例3	実施 例 4	実施 例 5	実施 例 6
1	記 合 茂 げ	ポリオール 1 2 3 4 発担収納用 触 媒 イソシアネートA	5 0.1 105	5 0.2 105	100 5 0.2 105	75 25 5 0.2 97	50 50 5 0.25 90	25 75 5 0.25	100 5 0.25 74
成形	ガラス形状態	120	80. ~90 有り	90 ~95 有り	55 ~70 有り	55 ~60 有り	35 ~40 有り	30 ~35 有り	
体の評価	<b>癸</b>	解復温度( で以上) さ (ショアーD) 認道値(20 で) g前の値(Tg-5 で)	130 86 73	85 86 72	90 86 67	82 89	55 79 72	40 74 72	30 73 73
	Tg彼の彼(Tg+5 で)			51	45	52	53	52	42

麦 2

	4	ita.	比較 例2	実施 例7	実施 例8	実施 例 9	
		ポリオール」	100		ŀ		
		2	1 1	100	ľ	1	
a	2	3			100	l	
6	<b>à</b>	. 4			!	100 5	
ħ	戈	発泡抑制剂	5	5	5		
3	<del>}</del>	独纵	0.2	0.3	0.3	0.3	
		イソシアネートB	112	112	112	79	
	ガラス	ス転移温度(で)	115	80	75	30	
成				~90	~80	~35	
形	形狀	己億性の有無判定	育り	育り	有り	有り	
体	形状值	動後温度( て以上)	120	85	75	30	
の	鲠	さ (ショアーD)					
å#	7	7温値(20 ℃)	86	84	82	73	
循	T,	g前の値(Tg-5 ℃)	70	72	67	73	
	T,	g後の値(Tg+5 で)	49	42	47	49	
				· •			

**∌** 3

No.			比較	実施	実施	実施	実施	実施	比較	
			<b>64</b> 3	9410	<i>9</i> 411	<b>6</b> 412	<del>9</del> 113	<i>野</i> 明4	154 4	
		ポリオー	-ル3		100	80	60	40	20	
az ¦		<u> </u>	5	100	1	!				
合 成 分		6 <b>%श</b> ्चिम्प्रसम्			!	20	40	60	80	100
				5	5	5	5	5	5	5
		触	煤	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5
	イソシアネートA		136	105	91	80	67	55	42	
	` i .			105	90	60	35	30	5	0 ℃
脫					~95	~65	~40	~35	~10	未满
形				行り	有り	有り	有り	有り	有り	無し
#	形状回復温度(で以上)			120	90	60	40	30	10	
Ø	硬	さ(ショブ								
拝	常温値(20 ℃)			86	86	86	76	73	65•	28
僑	Tg前の値(Tg-5 ℃)			76	67	75	75	73	65=	
	Tg彼の値(Tgi5 で)			60	45	51	51	50	36	

\*:0℃での測定値

## 特開平2-43213(5)

、もしくは不完全の場合。

#### ○形状回復温度

Tg未満の温度で変形が固定された当該成形体 を熱風乾燥機中で常温から昇温したとき固定され た変形が完全な元の形状に回復する時の温度。

### ○ポリヒドロキシル化合物

ポリオール1:エクセノール40050 (旭硝 子脚) ソルビトール系〇日価 4

0 0

ポリオール 2 : エクセノール 4 0 0 MP (旭硝

子冊)ペンタエリスリトール系

OH H6 4 0 0

ポリオール3:エクセノール430(旭硝子時

)グリセリン系OH価400

ポリオール4:エクセノール420 (旭硝子暢

)ジオール系OH価280

ポリオール5:エクセノール330 (旭硝子間

)グリセリン系〇H偏530

ポリオール6:エクセノール1030 (旭硝子

柳)グリセリン糸O-H 価-1-6-0-

〇有機ポリイソシアネート

イソシアネートA:ミリオネートMR-200

(日本ポリウレタン師)

イソシアネートB:ミリオネートMTL(日本

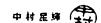
ポリウレタン(物)

〇副原料 --

発旭抑制剤:バイリット下パウダー(栗田工業

触媒:N, N´―テトラメチルヘキサメチレンジ

特許出願人



(以下余白)

(以上余白)